

### Abstract

Liq. photosensitive resins whose sensitivity is lowered by aging, etc., are reactivated by adding a solid O sorbent. The method is esp. useful for reactivation of resins which are easily degraded by contact with air. Thus, diethylene glycol 954, trimellitic anhydride 192, fumaric acid 696, and adipic acid 447 parts were reacted at 200° to give a polyester (acid value 105), the polyester 65 parts was mixed with acrylamide 7, tetraethylene glycol diacrylate 10, nonaethylene glycol diacrylate 18, benzoin Me ether 1.0, and p-methoxyphenol 0.02 part to give a liq. photosensitive resin, and the resin was aged 2 mo. in contact with air. The stored resin had very low sensitivity. An O sorbent Kepuron (from Kepuron K. K.) in a permeable bag was immersed in the aged resin for 5 days to restore the original sensitivity of the resin.

### Bibliographic Information

**Gas containing an extremely low amount of oxygen.** Iwabuchi, Shinichi; Kondo, Yoshinari; Tabata, Tetsuya. (Japan Pure Hydrogen Inc., Japan). Jpn. Tokkyo Koho (1975), 4 pp. CODEN: JAXXAD JP 50006440 19750313 Showa. Patent written in Japanese. Application: JP 70-123711 19701231. CAN 83:82169 AN 1975:482169 CAPLUS (Copyright 2003 ACS on SciFinder (R))

### Patent Family Information

Patent No.	Kind	Date	Application No.	Date
JP 50006440	B4	19750313	JP 1970-123711	19701231

Priority Application Information  
JP 1970-123711

19701231

### Abstract

The O in an inert gas, e.g. N, He, Ne, and Ar, is decreased to a very low level at ambient temp. by bringing the inert gas into contact with reduced Ni with a very small particle size. The reduced Ni surface can be regenerated in a stream of H at 30-200°. The reduced Ni is obtained by calcining a Ni salt, e.g. NiCO<sub>3</sub>, Ni(OH)<sub>2</sub>, Ni(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, NiC<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, or Ni(OAc)<sub>2</sub>, and reducing the product with H in the presence of a refractory material. Thus, Ar contg 2250 ppm O was passed at ambient temp. through a column filled with the Ni catalyst and the effluent Ar contained <0.1 ppm O. The H<sub>2</sub>O-content increase in the effluent Ar was much less than that corresponding to the O content of the feed gas.



特 許 願

(請)

昭和48年5月1日

特許庁長官 三宅幸夫 殿

① 日本国特許庁

# 公開特許公報

① 特開昭 50-6440

④ 公開日 昭50.(1975) 1.23

② 特願昭 48-55219

③ 出願日 昭48.(1973) 5.17

審査請求 有 (全2頁)

庁内整理番号

⑤ 日本分類

6780 35

121 A21

## 1、発明の名称

コウタツ 光沢のある 鈕の製造装置

## 2、発明者の住所氏名

特許出願人に同じ

## 3、特許出願人

香川県 大川郡 大川町 504

ムグルマヨシオ  
六車義雄

## 4、代理人

〒760 高松市郷東町583

(4566) 弁理士 馬場五男

## 5、添付書類の目録

(1) 明細書 1通

(2) 図面 1枚

(3) 願書副本 1通

(4) 審査請求書 1通

方式  
審査



## 明 細 書

### 1、発明の名称

光沢のある鈕の製造装置

### 2、特許請求の範囲

枠体Aの中心に偏心回転軸1を装備し、この偏心回転軸1の上に皿体Bを載架し、かつ、枠体Aと皿体Bとを発条2にて係合し、皿体Bの表面に凹所3を多数形成してなる光沢のある鈕の製造装置。

### 3、発明の詳細な説明

本案は光沢のある鈕を製造せんとするもので、その特徴は偏心回転させることにある。即ち、枠体Aの中心に偏心回転軸1を装備し、この偏心回転軸1の上に皿体Bを載架し、かつ、枠体Aと皿体Bとを発条2にて係合し、皿体Bの表面に凹所3を多数形成してなる構造に係るもので、偏心回転軸1の回転により、皿体Bは揺動し、凹所3に収納された樹脂はまんべんなく混合されて光沢を出していく。又、発条2にて枠体Aと皿体Bとは係合されているので皿体Bが揺動にて落下することはない。尚、枠体Aより上部に突出した支持棒4にて皿体Bが平行に保たれているので、凹所3の樹脂がこぼれることはない。

又、皿体Bと偏心回転軸1との係合は、皿体Bの下面中心部に凹所5を設け、この凹所5に空回転するように偏心回転軸1に係合する。

### 4、図面の簡単な説明

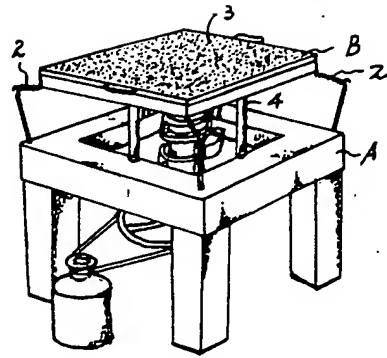
第1図は本発明の斜面図、第2図は要部の断面図を示す。

A……枠体、B……皿体、1……偏心回転軸、2……発条、3……凹所、4……支持棒、5……凹所

特許出願人 六車義雄

代理人 馬場五男

第1図



第2図

